

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年10月 1日
Date of Application:

出願番号 特願2003-343830
Application Number:

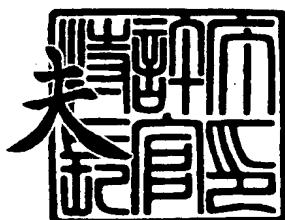
[ST. 10/C] : [JP 2003-343830]

出願人 本田技研工業株式会社
Applicant(s): 日本ケミコン株式会社
大同メタル工業株式会社

2003年11月26日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康



【書類名】	特許願
【整理番号】	H102339202
【提出日】	平成15年10月 1日
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	H01G 9/058 H01G 9/016
【発明者】	
【住所又は居所】	埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内
【氏名】	小山 茂樹
【発明者】	
【住所又は居所】	埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内
【氏名】	岩井田 学
【発明者】	
【住所又は居所】	埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内
【氏名】	小林 啓人
【発明者】	
【住所又は居所】	埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内
【氏名】	村上 顯一
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株式会社内
【氏名】	吉田 光一
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株式会社内
【氏名】	齊藤 弘幸
【発明者】	
【住所又は居所】	愛知県犬山市大字前原字天道新田 大同メタル工業株式会社内
【氏名】	尾崎 幸樹
【発明者】	
【住所又は居所】	愛知県犬山市大字前原字天道新田 大同メタル工業株式会社内
【氏名】	筒井 正典
【特許出願人】	
【識別番号】	000005326
【氏名又は名称】	本田技研工業株式会社
【特許出願人】	
【識別番号】	000228578
【氏名又は名称】	日本ケミコン株式会社
【特許出願人】	
【識別番号】	591001282
【氏名又は名称】	大同メタル工業株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100067356
【弁理士】	
【氏名又は名称】	下田 容一郎
【選任した代理人】	
【識別番号】	100094020
【弁理士】	
【氏名又は名称】	田宮 寛祉

● 【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-348947

【出願日】 平成14年11月29日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004466

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9723773

【包括委任状番号】 0011844

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

一对の集電箔に各々活性炭を主体とした電極物質を貼り付けることで正極電極及び負極電極を造り、これらの正負極電極間にセパレータを介在させると共に電解液を介在させ、前記一对の集電箔を通じて充電及び放電を行うことのできる電気二重層コンデンサにおいて、

電極物質を貼り付ける段階での前記集電箔は、以下の条件を満足するものを用いたことを特徴とする電気二重層コンデンサ。

- ・集電箔は、塩素イオンを含むエッティング液によりエッティング処理を施す。

- ・上記エッティング処理及び化成処理を施した箔の断面を観察し、上下のエッティング層の厚さの和をエッティング層の総和 t_1 としたときに、この総和 t_1 は皮膜耐電圧 65.5 V で化成処理することで得られる箔単体の単位表面積当たりの静電容量が $1.7 \mu F/cm^2$ 以上を満たすような厚みであること。

- ・上記エッティング処理及び化成処理を施した箔の断面を観察し、エッティングされていない層の厚さを非エッティング層の厚さ t_2 としたときに、この厚さ t_2 は、箔の引張り強さが $9000 N/cm^2$ 以上になる値であること。

【書類名】明細書

【発明の名称】電気二重層コンデンサ

【技術分野】

【0001】

本発明は電気二重層コンデンサに用いる集電箔に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、電気二重層コンデンサに相当する電気二重層キャパシタ、特にその集電箔（アルミニウム箔）の強度に注目した発明が知られている（例えば、特許文献1。）。

【特許文献1】特開平11-283871号公報（第2-3頁）

【0003】

特許文献1の第2頁【請求項3】第4行～第5行に「前記アルミニウム箔は、表面に1～5μmの厚さの粗面化層を有し・・・」と記載されている。

この理由は、特許文献1の第3頁段落番号【0013】第6行～第9行に「また、5μm超とすると接合力のさらなる向上はみられず、粗面化層の厚さが厚くなるほどアルミニウム箔の強度が低下する。特には2～4μmであると好ましい。」と記載されている。

【0004】

本発明者らが、特許文献1と同様に電極体、すなわち集電箔の強度に配慮しながら多数個の電気二重層コンデンサを試作し、それらの評価をした。この評価の結果、強度的には満足できるものの、シート状電極物質の貼り合せにおける接着強度が十分でなく、コンデンサの動作中に剥離などの不具合を起こし、蓄電池としての性能が著しく低いことが分かった。これは、強度確保を主体としたため、接着強度を高めるためのエッティング粗面化層の形成が不十分であったためと考えられる。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、電気二重層コンデンサにおいて、電極物質と箔との接着強度を十分に確保することができる技術を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者らは、箔の強度確保とシート状電極物質の接着性向上の双方を満足する電気二重層コンデンサを完成するべく、試作、検証を重ね、そのための条件を確立することに成功した。

【0007】

すなわち、請求項1は、一対の集電箔に各々活性炭を主体とした電極物質を貼り付けることで正極電極及び負極電極を造り、これらの正負極電極間にセパレータを介在させると共に電解液を介在させ、前記一対の集電箔を通じて充電及び放電を行うことのできる電気二重層コンデンサにおいて、

電極物質を貼り付ける段階での前記集電箔は、以下の条件を満足するものを用いたことを特徴とする電気二重層コンデンサ。

・集電箔は、塩素イオンを含むエッティング液によりエッティング処理を施す。

・上記エッティング処理及び化成処理を施した箔の断面を観察し、上下のエッティング層の厚さの和をエッティング層の総和 t_1 としたときに、この総和 t_1 は皮膜耐電圧 65.5 V で化成処理することで得られる箔単体の単位表面積当たりの静電容量が $1.7 \mu F/cm^2$ 以上を満たすような厚みであること。

・上記エッティング処理及び化成処理を施した箔の断面を観察し、エッティングされていない層の厚さを非エッティング層の厚さ t_2 としたときに、この厚さ t_2 は、箔の引張り強さが $9000 N/cm^2$ 以上になる値であること。

【0008】

非エッティング層の厚さを引張り強さが $9000 N/cm^2$ 以上になるように決めたので

● 、製造工程中に箔が切断する心配はない。

【発明の効果】

【0009】

請求項1では、エッチング層の総和を静電容量が $1.7\mu\text{F}/\text{cm}^2$ 以上になる厚さに決めたので、エッチング層形成が十分になり、電極物質と箔との接着強度を十分に確保することができ、この結果、コンデンサの電気的性能を発揮させることができる。

【0010】

同時に、非エッチング層の厚さを引張り強さが $9000\text{N}/\text{cm}^2$ 以上になるように決めたので、製造工程中に箔が切断する心配はない。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

本発明を実施するための最良の形態を添付図に基づいて以下に説明する。

図1は本発明に係る電気二重層コンデンサの斜視図であり、電気二重層コンデンサ10は、帯状の正極電極11と帯状の負極電極12とをセパレータ13を介して積層し、密に巻き、容器14に収納してなる円筒型電気二重層コンデンサである。

15は封止板、16は正極端子、17は負極端子、18は電解液を注入するための注液口である。

【0012】

図2は電気二重層コンデンサの断面拡大図であり、正極電極11は、アルミニウム箔などの集電箔21と、この集電箔21にシート状に貼り付けた活性炭素を主体とした電極物質22とからなる。負極電極12も、アルミニウム箔などの集電箔21と、この集電箔21にシート状に貼り付けた活性炭素を主体とした電極物質22とからなる。なお、集電箔21、21の裏面にも電極物質22、22を貼り付けるが、説明を簡単にするために図示を省略した。

【0013】

そして、電極物質22、22に適量の電解液を含浸させる。

正極端子16と負極端子17に直流を印可すると、電極物質22、22内部及び集電箔21、21の表面に正負イオンが吸着し、一方は正極、他方は負極を形成する。放電時においては、この吸着イオンが脱着することに伴う電子の移動により正・負極端子16、17を通じて電流を取出すことができる。

【0014】

図3は本発明に係る電気二重層コンデンサの製造フロー、特に集電箔の製造を詳しく説明するフロー図である。ST××はステップ番号を示す。

ST01：集電箔として、例えば純度が99.8%以上のアルミニウム箔を準備する。このアルミニウム箔の表面は実質的に平坦である。

【0015】

ST02：前記アルミニウム箔を、塩酸を含むエッチング液中でエッチングを施す。このエッチングにより、箔の表面に微細な粗面が形成される。微細な粗面は後に貼り付ける電極物質を繋ぎ止めるくさびとなる。

【0016】

粗面の形成が終了したら、箔を中和処理し、所定の洗浄する。所定の洗浄とは残留塩素濃度が管理基準($1.0\text{mg}/\text{m}^2$ 以下)を満足する程度に実施することを意味する。これにより、過剰な洗浄作業を行わぬ様にする。

【0017】

ST03：静電容量を測定する前処理として、箔から切出した箔片を、アジピン酸アンモニウムの水溶液に浸漬し、皮膜耐電圧65.5ボルトの電圧を印加することにより化成処理を施す。

【0018】

ST04：箔の静電容量Cを測定する。

図4は静電容量測定原理図であり、試験容器30にアジピン酸アンモニウムの水溶液3

1を満たし、そこに箔片21を浸漬し、この箔片21を囲う位置に対向電極32を配置し、箔片21と対向電極32と通電しつつ静電容量計33により、箔片21の静電容量を測定する。これで箔単体の静電容量Cが測定できることになる。

【0019】

図3に戻る。

ST05：箔単体の静電容量Cが、 $1.7 \mu F/cm^2$ 以上であるか否かを調べる。YESであれば次に進むが、NOであれば、不合格品扱いとする。

【0020】

ST06：箔を切断する。

ST07：金属顕微鏡で断面を観測し、非エッチング層の厚さt2を測定する。

図5はエッチング済み箔の断面図であり、符号t2が非エッチング層の厚さとなる。箔の厚さ（総厚さ）をTとすれば、エッチング層の総和t1は、 $(T - t2)$ で求めることができる。

【0021】

次のステップのために、引張り強さ $9000 N/cm^2$ に相当する非エッチング層の厚さTstdを決めておく。

ST06の箔の切断とは別に、箔から幅10mm、長さ（50mm+掴み代）のテストピースを切出し、このテストピースを、JIS B 7721の引張り試験機に掛けることで、箔の引張り強さを測定する。

【0022】

図6はある箔における非エッチング層の厚さと引張り強さの関係を調べたグラフである。このグラフを作成するのに用いたデータは後述する。

電気二重層コンデンサの製造過程に、帯状の箔を巻き取る工程が含まれるが、この巻き取りの際に箔に引張り力を加えるために、箔が切断する虞がある。これを避けるためには、アルミニウム箔の場合、引張り強さを $9000 N/cm^2$ 以上にすることが有効である。そこで、図の縦軸の9000から横線を引き、グラフとの交点から縦線を下ろすと、 $9 \mu m$ の厚さを得ることができる。この $9 \mu m$ を、引張り強さ $9000 N/cm^2$ に相当する非エッチング層の厚さTstdに当てればよい。

【0023】

ここでは、 $Tstd = 9 \mu m$ としたが、アルミニウム箔の成分が変化したときや、エッチング条件が変化したときや、アルミニウム以外の金属を箔に適用したときなどは、その都度、図6のグラフを作り直して、より最適なTstdを定める必要がある。

【0024】

図3に戻る。

ST08：測定した非エッチング層の厚さt2が、Tstd以上であるか否かを調べる。YESであれば次に進むが、NOであれば、不合格品扱いとする。

【0025】

ST09：以上の検査をクリアした箔についてのみ、電極物質をシート状にして接着などにより貼り付ける。

ST10：セパレータと共に捲回する。

ST11：容器に収納する。

ST12：封止板を取付ける。

ST13：電解液を注入する。

以上で、図1に示す円筒型電気二重層コンデンサを得ることができる。

【0026】

なお、ST03～ST08は、抜き取り検査にすることができる。この場合は主たる製造フローは、ST01→ST02→ST09～ST13になり、ST03～ST08はサブフローとする。

【0027】

また、ST03～ST08は、順序を入れ替えることは差し支えない。

【実施例】

【0028】

本発明に係る実施例を次に説明する。比較実験のために7個のサンプルを造る。

1. サンプルの材料：

1-1. 集電箔：

1-1-1. 実施例、比較例共通処理条件：

45℃に加熱された5%塩酸に原料アルミニウム箔を、浸漬し、電解電流密度0.25A/cm²、電気量（実施例、比較例毎に30～45の範囲で異なる値にする。値は次項で説明する。）A·min/dm²とした50Hz交流電流により表面をエッチングした。

エッチング槽から取出した箔を、50℃に加温されたpH1の酸性水溶液で1分間洗浄処理を行い、さらに180℃の温風で乾燥した。

【0029】

1-1-2. エッチングのための電気量

実施例1は、エッチングのための電気量を30A·min/dm²とした。

実施例2は、エッチングのための電気量を32A·min/dm²とした。

実施例3は、エッチングのための電気量を34A·min/dm²とした。

実施例4は、エッチングのための電気量を36A·min/dm²とした。

実施例5は、エッチングのための電気量を38A·min/dm²とした。

比較例1は、エッチングのための電気量を43A·min/dm²とした。

比較例2は、エッチングのための電気量を45A·min/dm²とした。

【0030】

以上の述べた各種集電箔に、以下の説明は共通に適用する。

1-2. 電極物質：

活性炭90重量部、黒鉛粉末5重量部及び四フッ化エチレン5重量部を混合し、混練し、成形し、圧延することで、厚さ145μm×幅100mm×長さ1200mmのシート状電極物質を造る。

1-3. 接着剤：

PVA（ポリビニルアルコール）、黒鉛及び不定形炭素からなる導電性接着剤

【0031】

1-4. セパレータ：

人造綿糸セパレータ。厚さ75μm×幅105mmの多孔性フィルム。

1-5. 容器：

径が40mmで高さが130mmの容器

1-6. 電解液：

有機系電解液としてのTEMA·BF₄／PC。なお、TEMA·BF₄はトリエチルメチルアンモニウムテトラフルオロボーレート、PCはプロピレンカーボネートである。

【0032】

2. サンプルの作り方：

上記集電箔の両面に、上記接着剤を用いて電極物質を貼り付ける。上記セパレータとともに捲回して、容器に収め、電解液を注入することで、円筒型電気二重層コンデンサを造る。比較実験に供するために7種類のサンプルを造る。

【0033】

3. 測定

3-1. 静電容量測定： 上述の方法による。

3-2. 引張り強さの測定： 上述の方法による。

3-3. 非エッチング層の厚さt₂の測定： 上述の方法による。

3-4. 箔の厚さ（総厚さ）Tの測定： 上述の方法による。

3-5. エッチング層の総和t₁の算出： 上述の計算法による。

【0034】

3-6. セル抵抗率の測定：

未使用のサンプルを対象とする。図1の正負極端子16、17に抵抗計を接続し、抵抗値A (Ω) を測定する。これに正負極用集電箔の面積B (cm^2) を乗じることにより、セル抵抗率 (Ωcm^2) を求める。すなわち、セル抵抗率 (Ωcm^2) = 抵抗値A (Ω) \times 正負極用集電箔の面積B (cm^2) となる。ただし、これは電極物質の厚さが145 μ m (1-2. 参照) であるときの値である。

【0035】

3-7. 2000 hr 後抵抗上昇率の測定：

前記セル抵抗率を測定した後に、45°Cの環境で、2.5ボルトの連続印加を行う。2000時間経過したら、印加を止める。

そして、常温の環境で、30アンペアに保ちながら定圧放電を開始し、2.5ボルトが1.0ボルトに低下したときに放電を終了する。

【0036】

この時点で、3-6. セル抵抗率の測定で述べたのと同手順で、2000 hr セル抵抗率を求め、この2000 hr セル抵抗率が、3-6. で求めたセル抵抗率に対して何%増加したかを計算する。この計算値を2000 hr 後抵抗上昇率と呼ぶことにする。

【0037】

表1は、実施例1～5及び比較例1～2について、電気量、静電容量、引張り強さ、非エッチング層の厚さ、箔の厚さ、エッチング層の総和、セル抵抗率及び2000 hr 後抵抗上昇率を記録した表である。この表の数値から各種のグラフを作成し、評価する。

【0038】

【表1】

	イッティングの電気量	65.5v 静電容量	引張り強さ	非イッティング層の厚さ ^{t2}	箔厚さT	イッティング層の総和 ^{t1}	セル抵抗率	2000hr後抵抗上昇率
単位	A·min/dm ²	μ F/cm ²	N/cm ²	μ m	μ m	μ m	Ω cm ²	%
実施例1	30	1.69	11360	18.5	40.3	21.8	3.29	14.2
実施例2	32	1.87	11050	17.3	40.1	22.8	3.26	14.0
実施例3	34	2.04	10350	14.9	39.9	25.0	3.29	13.4
実施例4	36	2.15	9830	12.6	39.8	27.2	3.32	13.2
実施例5	38	2.28	9030	8.7	39.1	30.4	3.49	15.1
比較例1	43	2.41	8560	6.5	39.1	32.6	3.82	16.3
比較例2	45	2.54	7830	4.0	38.8	34.8	4.30	16.9

【0039】

図7は非エッティング層の厚さと引張り強さの関係を示すグラフであり、グラフ中の○は実施例、△は比較例を意味する。

9000 N/cm² の引張り強さを得るには非エッティング層の厚さは 9 μm が必要である。逆に、非エッティング層の厚さが 9 μm 以上あれば、必要な引張り強さ (9000 N/cm²) 以上が得られると言える。

【0040】

図8は非エッティング層の厚さと 2000 hr 後抵抗上昇率の関係を示すグラフである。2000 hr 後抵抗上昇率は、経年変化の度合いを示し、経年劣化が大きいほど値は大きくなるから、値が小さいほど良好であると言える。○は全てが 15.0 % 以下であり、△より小さい。

t_2 が 9 μm 以上あれば、2000 hr 後抵抗上昇率も良好であることが確認できた。

【0041】

図9はエッティング層の総和と静電容量の関係を示すグラフであり、グラフ中の○は実施例、△は比較例を意味する。

エッティングは、静電容量を高めるために実施する処理であり、エッティング層の総和が増加するほど、静電容量が増加することが確かめられた。エッティング層の総和が 22 μm 以上あれば、必要な静電容量 (1.7 μF/cm²) 以上が得られる。

【0042】

図10はエッティング層の総和と 2000 hr 後抵抗上昇率の関係を示すグラフであり、グラフ中の○は実施例、△は比較例を意味する。

2000 hr 後抵抗上昇率は、経年変化の度合いを示し、経年劣化が大きいほど値は大きくなるから、値が小さいほど良好であると言える。

横軸に示すエッティング層の総和が 30 μm を超えると、2000 hr 後抵抗が上昇し好ましくない。

【0043】

従って、エッティング層の総和は (22~30) μm の範囲に収めることが望ましい。上述の表1の右から4番目の欄に示すとおりに、箔の総厚さ (平均値) は約 39 μm であった。

のことから、エッティング層の総和 t_1 が (22~30) μm あれば、箔単体の単位表面積当たりの静電容量が 1.7 μF/cm² 以上になる。

そして、非エッティング層の厚さ t_2 が (9~17) μm あれば箔の引張り強さが 9000 N/cm² 以上になる。

【0044】

尚、集電箔はアルミニウム箔で説明したが、その他の金属箔でも良い。

また、本発明は円筒型コンデンサの他、平板型コンデンサにも適用できるため、コンデンサの外観的形状は任意である。

【産業上の利用可能性】

【0045】

本発明に係る電気二重層コンデンサは、車載バッテリに好適である。

【図面の簡単な説明】

【0046】

【図1】本発明に係る電気二重層コンデンサの斜視図である。

【図2】電気二重層コンデンサの断面拡大図である。

【図3】本発明に係る電気二重層コンデンサの製造フロー、特に集電箔の製造を詳しく説明するフロー図である。

【図4】静電容量測定原理図である。

【図5】エッティング済み箔の断面図である。

【図6】ある箔における非エッティング層の厚さと引張り強さの関係を調べたグラフである。

【図7】非エッティング層の厚さと引張り強さの関係を示すグラフである。

【図8】非エッティング層の厚さと 2000 hr 後抵抗上昇率の関係を示すグラフであ

る。

【図9】エッティング層の総和と静電容量の関係を示すグラフである。

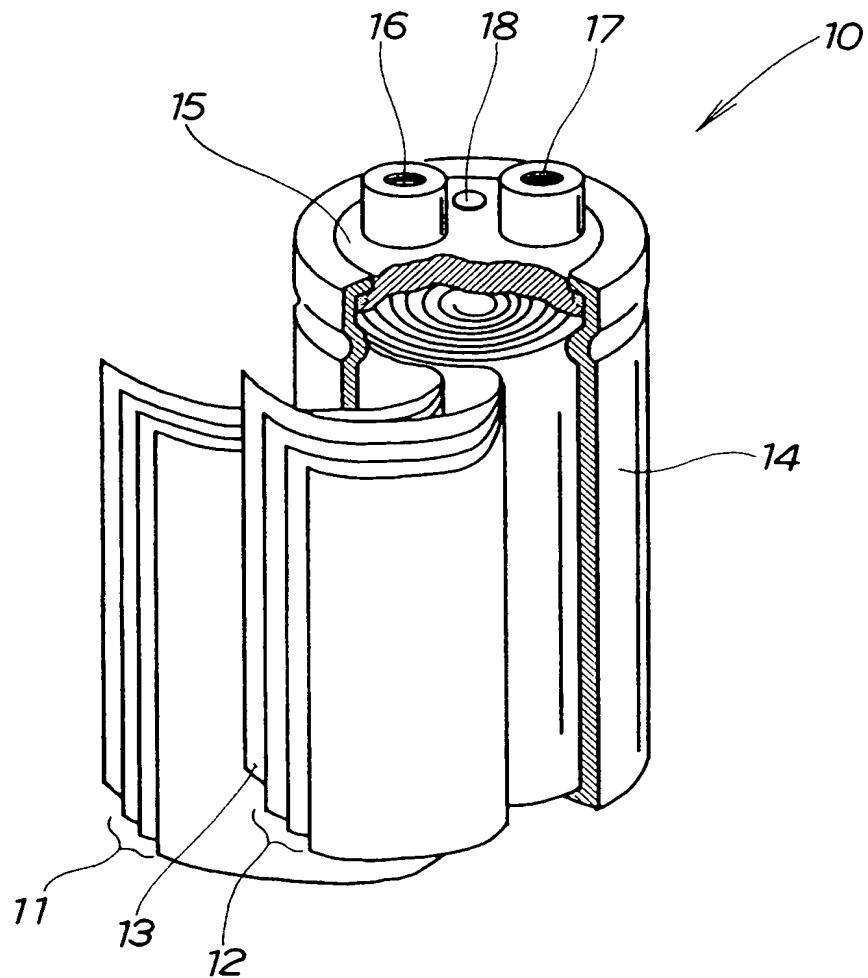
【図10】エッティング層の総和と2000 hr後抵抗上昇率の関係を示すグラフである。

【符号の説明】

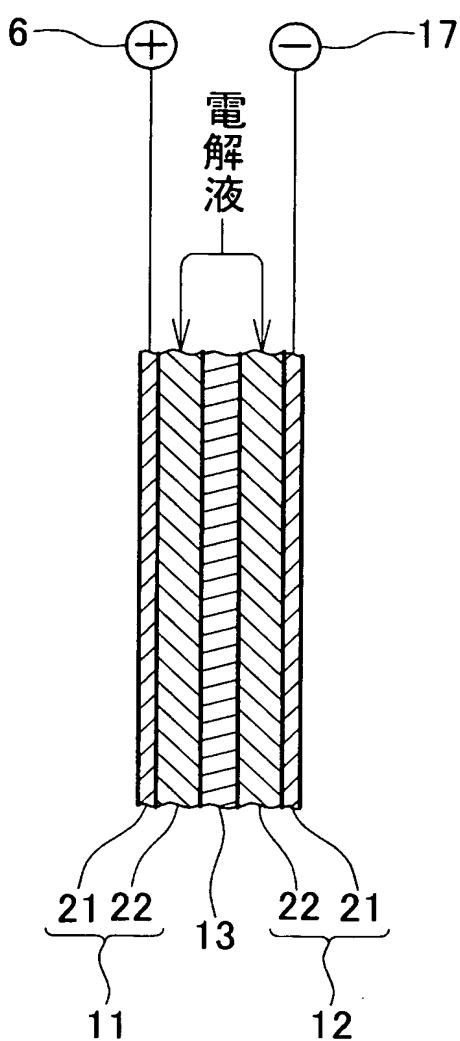
【0047】

10…電気二重層コンデンサ、11…正極電極、12…負極電極、13…セパレータ、
21…集電箔(箔)、22…電極物質。

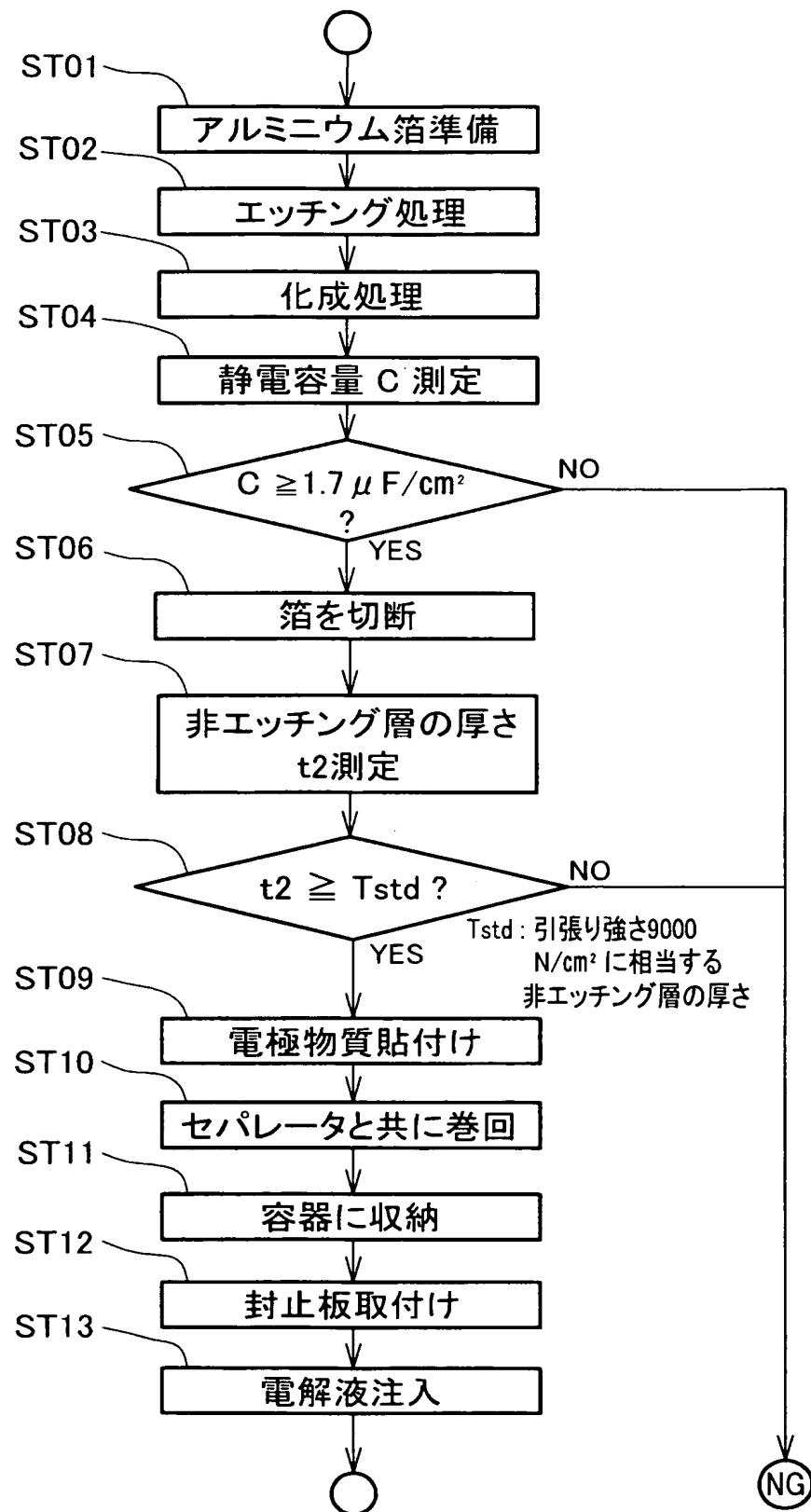
【書類名】図面
【図 1】



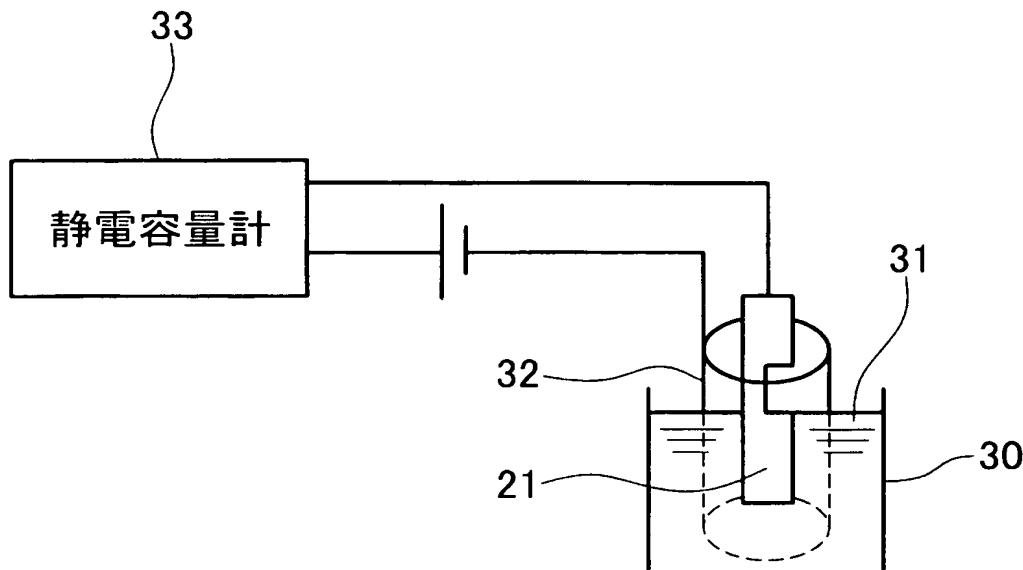
【図2】



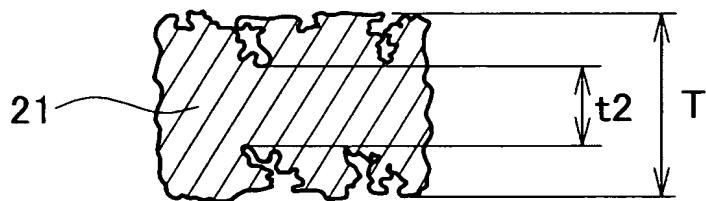
【図3】



【図 4】



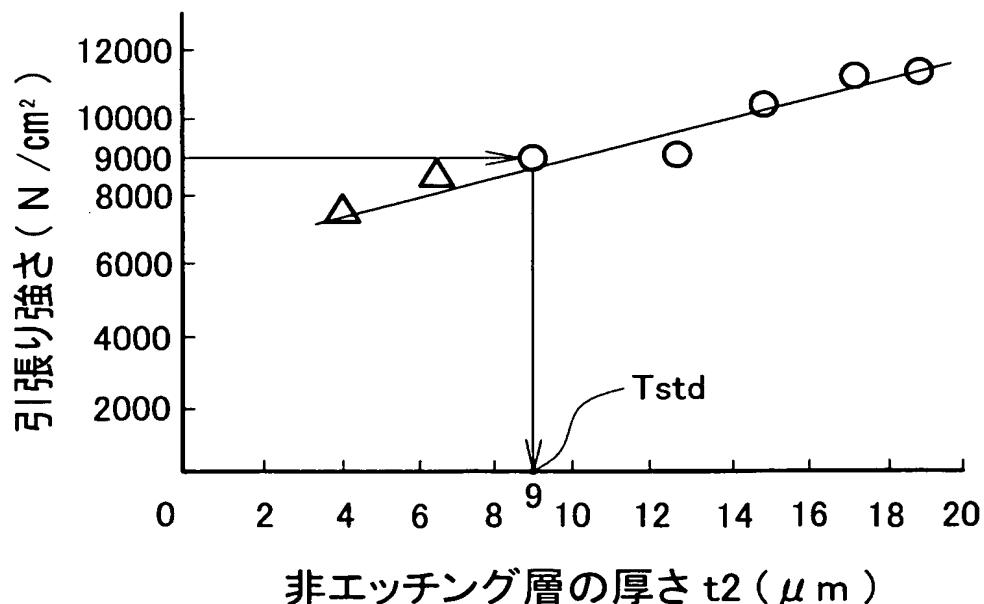
【図 5】



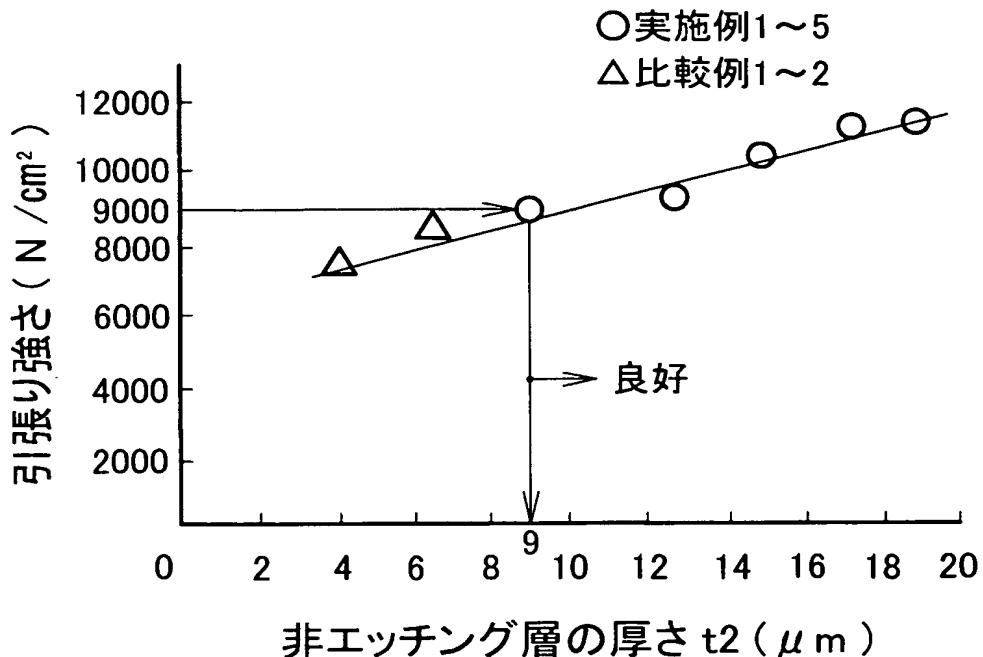
T: 箔の厚さ

t2: 非エッティング層の厚さ

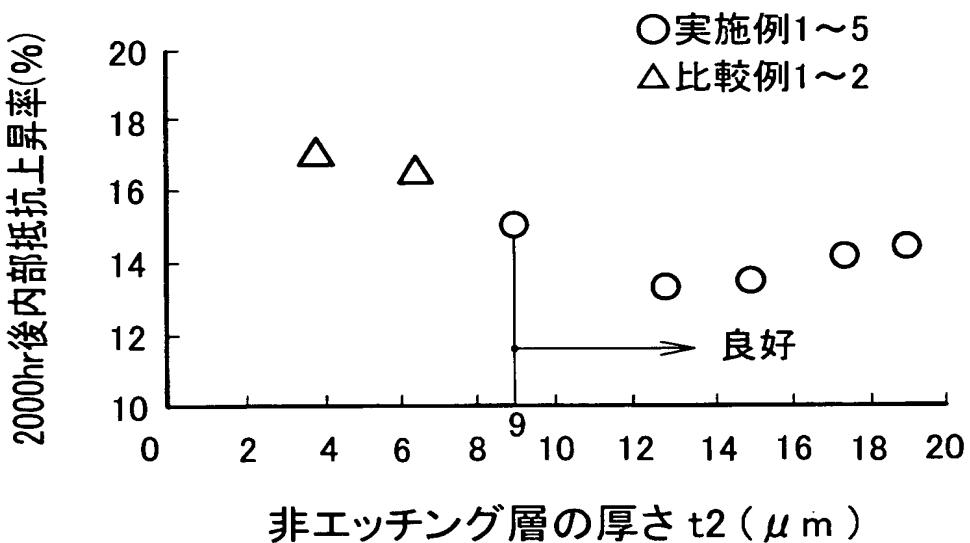
【図 6】



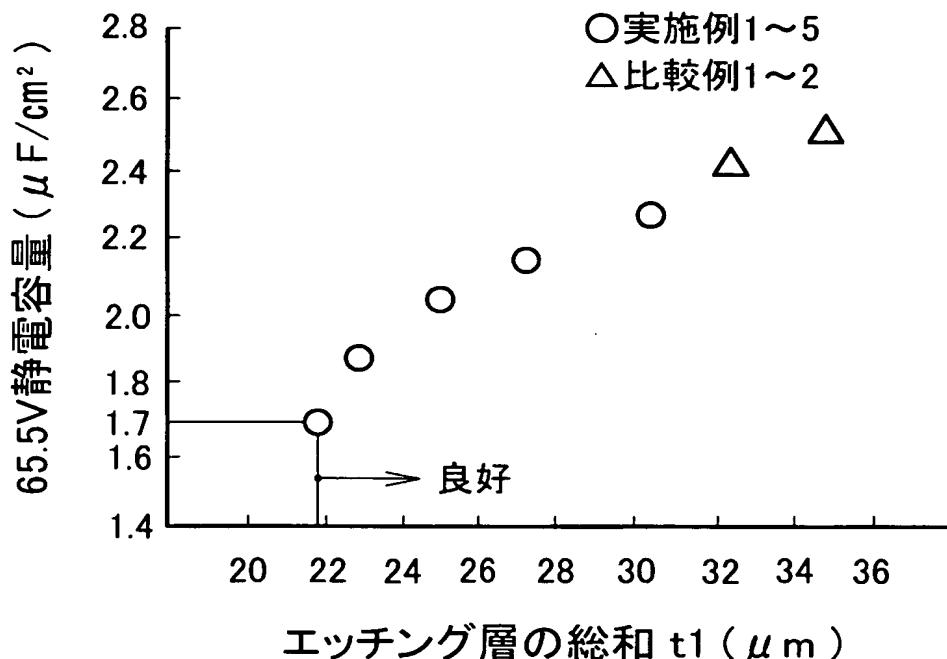
【図 7】



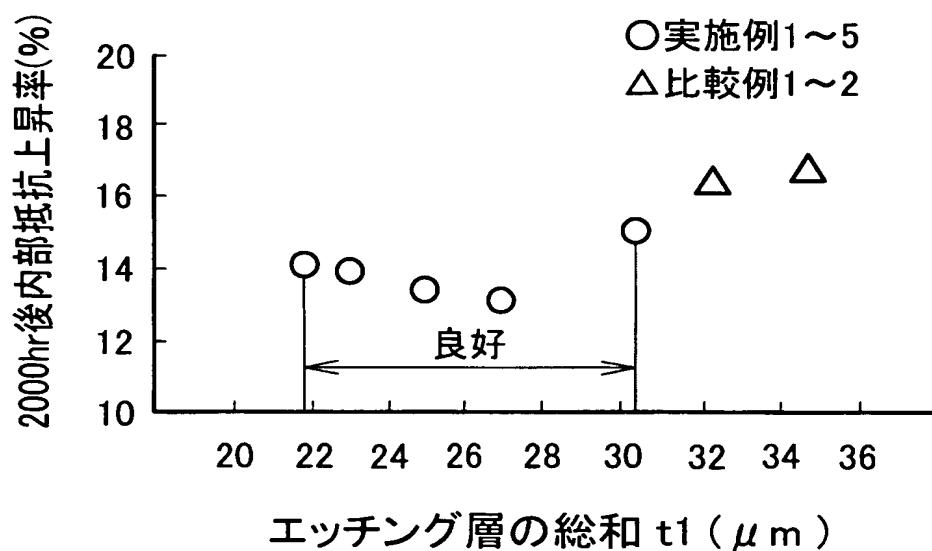
【図 8】



【図9】



【図10】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 電気二重層コンデンサにおいて、電極物質と箔との接着強度を十分に確保することができる技術を提供することを課題とする。

【解決手段】 非エッティング層の厚さを $9 \mu m$ 以上にすることにより、必要な引張り強さを確保しつつ、蓄電池としての性能を維持させることができる。

【効果】 非エッティング層の厚さを引張り強さに基づいて決めたので、製造工程中に箔が切断する心配はなくなる。これに伴ってエッティング層の総和を静電容量が $1.7 \mu F/cm^2$ 以上になる厚さに決めればエッティング層形成が十分になり、電極物質と箔との接着強度を十分に確保することができる。

【選択図】

図 8

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-343830
受付番号	50301633828
書類名	特許願
担当官	土井 恵子 4264
作成日	平成 15 年 10 月 22 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000005326
【住所又は居所】	東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号
【氏名又は名称】	本田技研工業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】	000228578
【住所又は居所】	東京都青梅市東青梅 1 丁目 167 番地の 1
【氏名又は名称】	日本ケミコン株式会社

【特許出願人】

【識別番号】	591001282
【住所又は居所】	愛知県名古屋市中区栄二丁目 3 番 1 号 名古屋広 小路ビルディング 13 階
【氏名又は名称】	大同メタル工業株式会社

【代理人】

【識別番号】	100067356
【住所又は居所】	東京都港区赤坂一丁目 1 番 12 号 明産溜池ビル 8 階 下田・田宮特許事務所
【氏名又は名称】	下田 容一郎

【選任した代理人】

【識別番号】	100094020
【住所又は居所】	東京都港区赤坂 1 丁目 1 番 12 号 明産溜池ビル 8 階 下田・田宮特許事務所
【氏名又は名称】	田宮 寛祉

特願2003-343830

出願人履歴情報

識別番号 [000005326]

1. 変更年月日 1990年 9月 6日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区南青山二丁目1番1号
氏 名 本田技研工業株式会社

特願2003-343830

出願人履歴情報

識別番号 [000228578]

1. 変更年月日 1990年 8月 3日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1
氏 名 日本ケミコン株式会社

特願2003-343830

出願人履歴情報

識別番号 [591001282]

1. 変更年月日 [変更理由]	1990年12月27日 新規登録
住 所	愛知県名古屋市北区猿投町2番地
氏 名	大同メタル工業株式会社
2. 変更年月日 [変更理由]	2002年 9月17日 住所変更
住 所	愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング13階
氏 名	大同メタル工業株式会社